

日本真空協会 2012年2月研究例会
日本表面科学会 第71回表面科学研究会
表面から少し深い領域を正確に評価するための新技術

スマートフォンに代表されるように技術開発を基に技術開発が新たな需要を生み出し、さらに市場における需要の拡大により新たな技術開発が促進されるという好循環を形成しています。21世紀の産業の糧は、如何にして材料の表面・界面を制御して必要とする機能を発現させるかにあるといっても過言ではありません。日本の優れた産業技術は、長い年月の蓄積から生まれる基礎科学に基づいた材料開発力に支えられてきました。表面・界面の性質はナノテクノロジーと関連して、ますます重要な問題となっています。それを支えてきたのが表面評価技術です。本研究会では、最近注目を集めている表面・界面評価手法を取り上げました。利用者の視点を交えて議論する機会として多数のご参加をお待ちしております。

1. 開催日時 2012年2月2日(木) 13:00-16:45 (受付 12:30~)

2. 場所 東京理科大学 森戸記念館 第1会議室

3. プログラム

13:00-13:05

開会あいさつ

深津 晋 (日本表面科学会企画委員長)

(1) 13:05-13:45

「Spring-8におけるHAXPESの現状と将来」

吉川英樹 (独物質・材料研究機構)

(2) 13:45-14:25

「収差補正STEMを用いたEDX/EELSによる界面の分析の現状」

川崎直彦 (東レリサーチセンター)

(3) 14:25-15:05

「アトムプローブによる3次元元素分析の現状と将来」

永井康介 (東北大学)

(15:05-15:20 休憩)

(4) 15:20-16:00

「Arクラスターを用いたXPS深さ方向分析の現状と将来」

宮山卓也 (アルバック・ファイ㈱)

(5) 16:00-16:40

「Arクラスターを用いたTOF-SIMS深さ方向分析の現状と将来」

松尾二郎 (京都大学)

16:40-16:45

閉会あいさつ

杉山直治 (日本真空協会 講演・研究会企画委員会委員長)

4. 参加費 (当日会場にてお支払いください。)

日本真空協会会員, 日本表面科学会会員 : 1,500円

非会員 : 2,500円

学生 : 無料

予稿集 : 1,000円

5. 申込方法

ウェブサイト (<http://www.sssj.org/>) または e-mail を使い、次の項目を記入してお申込ください。

氏名 (ふりがな), 所属, 連絡用 e-mail アドレス, 参加区分 (会員 (協賛学会員を含む), 学生, 一般)

締め切り : 1月20日(金)

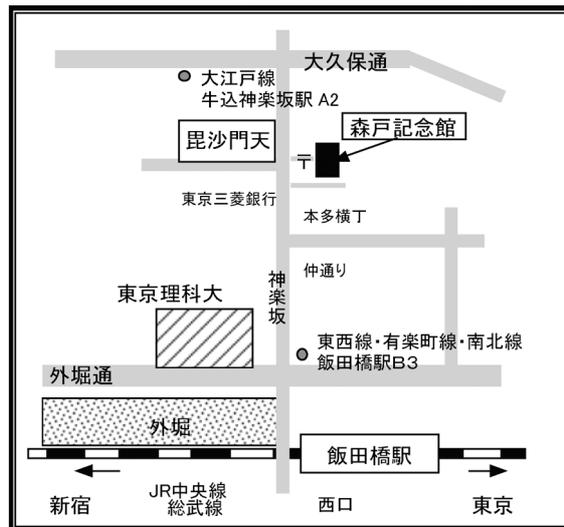
6. 申し込み先

日本表面科学会 TEL : 03-3812-0266 FAX : 03-3812-2897 e-mail : shomu@sss-j.org

*お申込に際しご記載いただきましたメールアドレスは、日本真空協会、日本表面科学会が主催する本件以外のセミナー・講演会などのご案内にも使用させていただく場合がございます。ご案内が不要な方はお手数ですがその旨お申し出ください

い.

7. 会場案内



一般社団法人 日本真空協会

〒105-0011 東京都港区芝公園 3-5-8 機械振興会館306号室

電話 03(3431)4395 FAX 03(3433)5371

E-mail : ofc-vs@vacuum-jp.org URL : <http://www.vacuum-jp.org/>

講演・研究会企画委員会 大岩 烈 (オミクロンナノテクノロジージャパン(株)), 中村 恵 (キヤノンアネルバ(株))

公益社団法人 日本表面科学会

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-40-13 本郷コーポレイション402

電話 03(3812)0266 FAX 03(3812)2897

E-mail : shomu@sss-j.org URL : <http://www.sss-j.org>